

平成28年度採択 「高速成膜と密着性を両立した低コストDLC成膜技術の開発」 ナノテック株式会社（千葉県） 主たる技術：表面処理

- ・真空引きを5分に短縮しタクトタイムを1/5に高速化
- ・大量生産に必要な短時間で高品質のDLC成膜が可能
- ・様々な形状を有する部品に短時間で高機能なDLCコーティングを実現

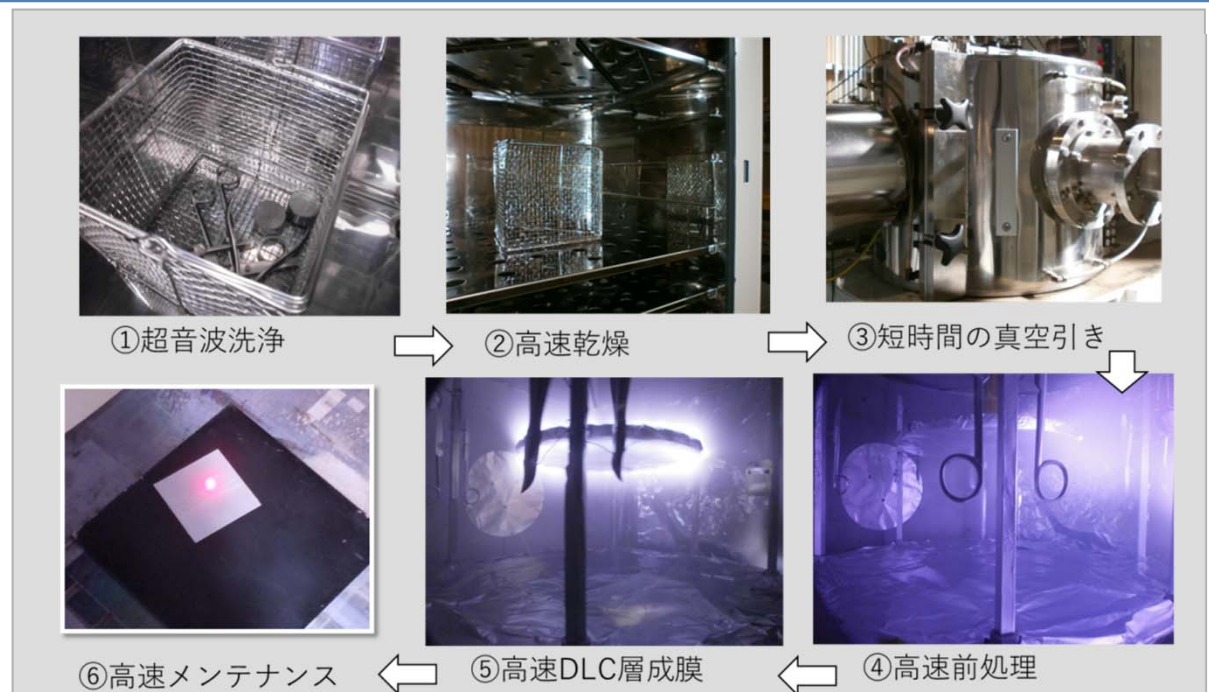
研究開発の成果

■ タクトタイムが従来の真空での成膜法に比べて1/5の高速

- ・トータルプロセスのタクトタイムを短縮し各要素技術のレベルの向上で達成

■ 低コストで高品質なDLC膜

- ・高硬度（HV換算値HV1600）達成
- ・低摩擦係数（0.2以下）達成



研究体制

事業管理機関 一般社団法人産学金連携推進機構

ナノテック株式会社

学校法人慶應義塾

当該研究開発の連絡窓口

所属・氏名：ナノテック株式会社 平塚 傑工
E-mail：hiratsuka@nanotec-jp.com
電話番号：04-7135-6111